

機種名	高温型赤外線真空炉
メーカー	サーモ理工
型式	IVF298W
利用目的	試料を真空・各種ガス雰囲気下で赤外線集光照射により急速昇温、クリーン加熱
特色	最高昇温速度 100°C/sec、加熱時間 1500°Cまで約 1min 熱源からの放出ガスや電磁誘導の影響を与えないクリーン加熱 赤外線放射部、真空チャamber、プログラム温度制御器、安全装置で構成した 卓上型赤外線真空炉
用途	真空中／ガスフロー中での試料アニール シリコン、SiC 等半導体試料や酸化物の熱処理 グラフェン、CNT の加熱 高耐熱金属、セラミックス、複合材料等超高温材料の昇温試験 酸素、水素等のガスフロー中アニール 濡れ性試験
忌避対象	有毒ガスの発生，腐食性ガスの発生，真空中加熱により昇華する試料，液体を含む試料
担当	大坪
連絡先	info(at)kitcia.kyutech.ac.jp に連絡



概要

本装置は、高温型赤外線真空炉です。

赤外線集光照射による、試料の急速昇温、クリーン加熱が簡単にできます。

昇温・加熱は、真空中及び各種ガス雰囲気で行えます。

標準は、大気中あるいは真空中雰囲気です。

なお、各種ガス雰囲気での使用においては、ガスは設備利用者の方で準備して頂きます。

さらに、原則持ち込みガスボンベは使用後、お持ち帰りいただきます。

仕様・性能

赤外線ランプ定格：2kW

最高到達温度 ：1500℃

加 熱 面 積 ：～φ20mm

最大昇温速度 ：100℃/sec

最大到達真空度 ： 5×10^{-4} Pa

冷 却 水 量 ：2L/min

利用方法

- ・利用者ご自身で操作していただきます。
- ・簡易操作マニュアルを設置しております。